

Ptfe Wafer-Reinigungskorb 4 Zoll Ätzgestell Säure- Und Laugenbeständig Individueller Maskenträger

Artikelnummer: PL-CP90



Einführung

Präzisionsgefertigte PTFE-Ätzkörbe für die Halbleiter-Waferreinigung und chemische Prozesse. Diese säurebeständigen, hochreinen Reinigungsgestelle gewährleisten Null-Kontamination in anspruchsvollen Laborumgebungen. Vollständig anpassbar, um spezifische industrielle Masken- und Waferabmessungen für fortschrittliche Fertigungs- und Forschungsanwendungen zu erfüllen.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Halbleiter-Nassätzen	Eintauchen von Siliziumwafern in saure Lösungen zum Entfernen dünner Schichten oder Reinigen von Oberflächen.	Vollständige Beständigkeit gegen HF und andere aggressive Ätzmittel gewährleistet Null-Materialabbau.
Photonenmaskenreinigung	Tragen empfindlicher Quarzmasken durch spezialisierte chemische Wasch- und Spülzyklen.	Kontakt mit materialschonendem Material verhindert Oberflächenschäden an komplexen Maskenmustern.
Solarzellenfertigung	Verarbeitung von Photovoltaik-Wafern während der Texturierungs- und Dotierungsreinigungsphasen.	Hohe Durchsatzkapazität und chemische Stabilität verbessern die Gesamtfertigungseffizienz.
MEMS-Verarbeitung	Handhabung von mikroelektromechanischen Systemen in verschiedenen chemischen Ätzumgebungen.	Präzisionsschlitze stellen sicher, dass kleine und fragile Komponenten während der Bewegung sicher gehalten werden.
Spurenanalyse	Reinigung von Laborgeräten und Behältern in hochreinen Säurebädern vor analytischen Tests.	Vermeidet Kreuzkontamination durch Bereitstellung einer metallfreien Reinigungs Umgebung.
Nanotechnologieforschung	Handhabung experimenteller Substrate in neuartigen chemischen Lösungen und reaktiven Umgebungen.	Vielseitigkeit in Temperatur- und chemischer Kompatibilität unterstützt verschiedene Forschungsprotokolle.

Merkmal	Spezifikationsdetails für PL-CP90
Modellnummer	PL-CP90
Materialkonstruktion	Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen)
Wafergrößen-Kompatibilität	4-Zoll (Standard) / Vollständig anpassbare Abmessungen
Schlitzkonfiguration	Anpassbare Anzahl von Schlitzen und Schlitztellungsabstand
Chemikalienbeständigkeit	Universelle Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Betriebstemperaturbereich	-200°C bis +260°C
Oberflächenbeschaffenheit	Präzisions-CNC-bearbeitet / Ultra-niedrige Oberflächenrauheit
Griffdesign	Abtrennbare oder feste Stile erhältlich (Anpassbar)
Entwässerungsdesign	Hochdurchfluss-Open-Framework-Geometrie
Fertigungsmethode	End-to-end kundenspezifische CNC-Fertigung

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Merkmal	Spezifikationsdetails für PL-CP90	
Bestelltyp	Kundenspezifische Produkte basierend auf Kundenspezifikationen	